

SEMICON Japan 2017 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、リソテックジャパンは本年もSEMICON Japan 2017に出展いたします。つきましては、ご来場の上、弊社ブース【東5ホール5633】へお立ち寄りいただきたく、ご案内申し上げます。

敬具

平成29年11月 吉日
リソテックジャパン株式会社
代表取締役 南洋一

今回リソテックジャパンブースでは、レジスト塗布/現像、レジスト評価/解析等の半導体リソグラフィに関連する製品を展示し、レジスト塗布、露光、現像等のプロセスに関わるシステムから弊社の最新評価技術までをご紹介します。また、ミクロンサイズの極小エリアを高輝度に照明可能な米国Energetiq社製LDLS*光源と、その応用技術についてもご案内します。

レジスト減圧乾燥ユニット
LTVCD



透過率測定装置
DUVTA-180



スピンドル
Litho Spin Cup



非接触式膜厚測定装置
Foothill L-2



LDLS 高輝度白色光源
EQ-99XFC



<主な展示予定製品>

*LDLSは、真空紫外から近赤外までフラットな波長特性を有し、かつ長寿命な全く新しい励起白色スポット光源です。



SEMICON
JAPAN

<開催概要>

名称 SEMICON Japan 2017
会期 2017年12月13日(水) 10:00~17:00
2017年12月14日(木) 10:00~17:00
2017年12月15日(金) 10:00~17:00
会場 東京ビッグサイト 東展示棟、会議棟
リソテックジャパン展示ブース 東ホール 5 No.5633
主催 SEMI <http://www.semiconjapan.org/register>(登録)

ご来場いただくには、事前にSEMICON Japan Webサイトで登録が必要です。登録後の画面、または登録確認メールからプリントアウトしたバッジで入場いただけます。

